This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



Translation of Claim 1 of the Citation

Claim 1:

A method for soldering a part to a substrate (i.e., a method for soldering the part to the substrate), characterized by comprising: a process of supplying soldering materials to a soldering position of a soldering substrate part; a process of pre-heating the parts included in the process of contacting parts to the soldering materials; and a process of heating from a back side of the soldering materials supplied to the substrate so as to melt the soldering materials while pre-heating the parts to contact with the soldering materials.

91118795

中華民國專利公報(19)(12)

(II)公告編號: 359881

(44)中華民國88年(1999)06月01日

發 明

全 3 頁

~(51) Int·Cl6: H01L23√495 H05K3√34

(54)名

稍:零件對基材之接合方法及其裝置,整半導體晶片對導框之接合方法及其裝置

(21)申 請 案 號:85101116

(22)申請日期:中華民國85年(1996)01月30日

(72) 發明人:

荒川功

日本

平田義典

日本

松永和人

日本

有团陵暗

日本

(71)申 請 人: 三菱電機股份有限公司

日本

5.

〔74〕代 理 人:賴輕臣 先生

1

2

[57]申請專利範圍::

- 1.一種零件對基材之接合方法,係指將零件接合於基材之方法,其特徵在於:包含將接合材料供給接合基材零件的接合位置之製程;及在使零件觸接前述接合材料之製程內具有預熱前述零件之製程,且一面預熱前述零件而一面使之觸接前述接合材料的同時,將供給基材之前述接合材料的位置從其背側之面加熱而使前述接合材料熔融之製程者。
- 2.一種零件對基材之接合裝置,係指將零件接合於基材之裝置,其特徵在於:包含將接合材料供給接合基材零件的接合位置之機構;及在使零件觸接前述接合材料之機構內具有預熱前述零件一面使之觸接前述接合材料的同時,將供給基材之前述接合材料的位置從其背側之面加熱而使前述接合材料熔融之機構者。
- 3.一種半導體晶片對引線框架之接合方法,係指將半導體晶片接合於引線框架

之方法,其特徵在於:包含將焊錫供給引線框架的小片觀墊上之製程;及在使半導體晶片觸接前述焊錫的製程內具有預熱半導體晶片的製程,且一面預熱前述半導體晶片而一面使之觸接前述焊錫的同時,將前述小片觀墊從供給前述焊錫之面的背側加熱而使前述焊錫熔融之製程者。

- 4.一種半導體晶片對引線框架之接合裝置,係指將半導體晶片接合於引線框架之裝置,其特徵在於:包含將焊錫供給引線框架的小片觀墊上之機構;及在使半導體晶片觸接前述焊錫之機構內具有預熱半導體晶片之預熱機構,且一面以前述預熱構預熱前述半導體晶片而一面使之觸接前述焊錫的同時,將前述小片觀墊從供給前述焊錫之面的背側加熱而使前述焊錫熔融之機構者。
- 5.如申請專利範圍第4項之半導體晶片對 20. 引線框架之接合裝置,其中預熱機係具

的半導體晶片對小片觀墊之接合裝置全體 構造的圖。

備由加熱器及夾頭預熱部而預熱的夾頭 的半導體晶片對小人者。 構造的圖。 第四周為 顯示

第四圖為顯示習知半導體晶片對小 片觀墊之接合裝置全體構造的圖。

第五圖為顯示第四圖之裝置焊接部

圖式簡單說明:

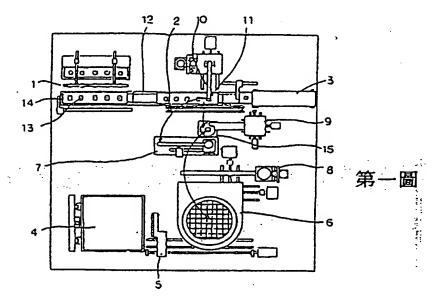
□面面。

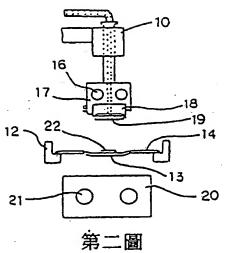
第一圖為顯示依據本發明實施例 1 的半導體晶片對小片觀墊之接合裝置全體 構造的圖。

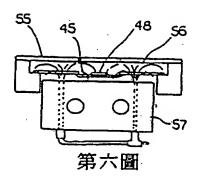
造的圖。 的一部分截面透視圖。 的一部分截面透視圖。 第二圖為第一圖之裝置的一部分截 第六圖為第四圖之裝置之

第三圖為顯示依據本發明實施例2

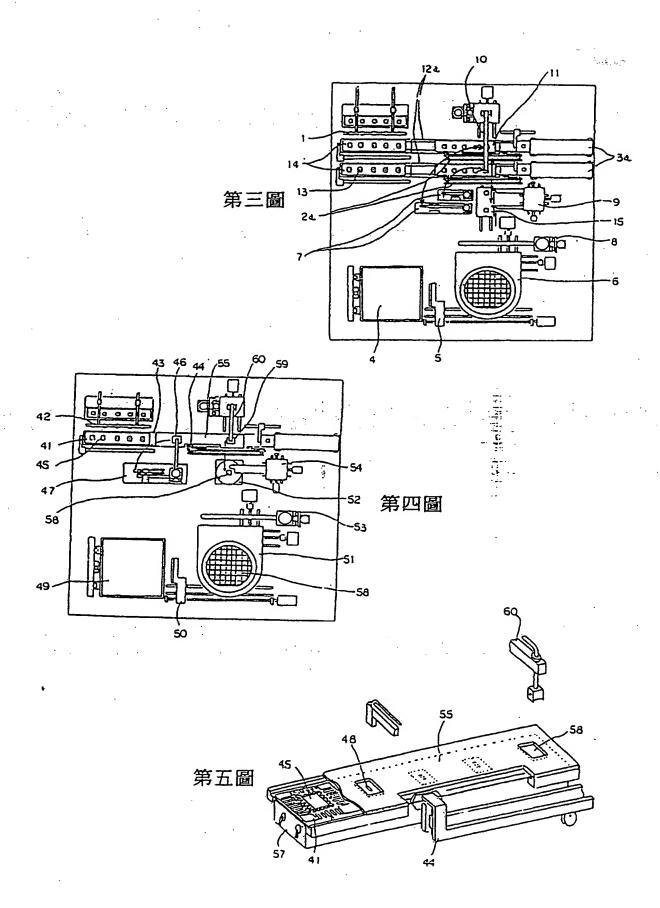
第六圖為第四圖之裝置之氣體環境 氣部的截面圖。



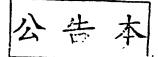




- 1922 -



THIS PAGE BLANK (USPTO)



353831

申請日期	85.1.30
策	85101116
#Int.·Gil	HOLL 195. HOSK TO

359881 c4

(₁₄)	上各棚山本局填注)
一、發明	中 文 零件對基材之接合方法及其裝置,暨半導體晶片對
新型石研	英 文 ————————————————————————————————————
	(1) 荒 川 功 姓 名(2) 平 田 義 典 (3) 松 永 和 人 (4) 有 國 隆 晴
四四二、發明人 住、	図 籍日 本
	(1)日本國熊本縣菊池郡大津町大字高尾野字平成272番10號 住、居所 三菱電機熊本セミコンダクタ株式會社内 (2)(3)(4)同(1)
*	姓 名三菱電機股份有限公司 (名稱) (三菱電機株式會社)
三、申請人	住、居所 (事務所) 日本國東京都千代田區丸の内2丁目2番3號
	代表人 姓 名 北 岡 隆

經濟部中央標準局員工消費合作社印製

四、中文發明摘要(發明之名稱: 零件對基材之接合方法及其裝置, 暨半導體晶片對引線框架之接合方法及其裝置

本發明提供一種接合時不需要供給氧化抑制氣體及遷原氣體的半導體晶片等零件對引線框架等基材之接合方法及其裝置。

接合方法包含將焊錫或銀焊料等接合材料供給接合基材 學件的接合 位置之製 程;預熱零件,同時使零件觸接的投入數程;及,將放基材之前 遊 接合 材料的位置,將放 接合 材料 條 終 沒 合 材料 好 粉 接 合 校 料 货 份 報 等 接 合 材料 供 絡 接 合 接 份 粉 將 以 將 發 接 合 材料 供 緣 接 合 接 份 粉 將 於 基 材之 簡 被 接 合 材料 的 位置 從 告 材料 之 機構;及,將 放 基 材之 前 述 接 合 材料的位置 從 自 材料之 機構;及,將 放 基 材之 前 述 接 合 材料的位置 從 其 別 即 之 面 加 熱 而 使 前 述 接 合 材料 熔 融 之 機構。

A6 ' B6

本案已向:

日 本 國 (地區) 申請專利,申請日期 1995-11-8 案號:7-290011,□有 図無主張優先權

÷ ien

有關微生物已寄存於:

, 寄存日期:

, 寄存號碼:

(请先阅请背面之注意事項再填寫本頁各關)

經濟部中央標準局員工消費合作社印製

五、發明説明(1)

[發明所屬之技術領域]

本發明係關於一種適合熔融焊錫或銀焊料等接合金屬而將零件與基材接合之接合方法及接合裝置,特別是關於一種最適合將半導體晶片小片焊接於引線框架上之接合方法及接合裝置。

[習知技術]

圖 4為習知零件對基材之焊接裝置的全體構造圖,圖 5為 此圖 4之裝置焊接部的一部分截面透視圖,圖 6為此圖 4之 裝置內的氧化抑制氣體環境氣部截面圖。在利用此習知焊接裝置的焊接方法方面,將焊 錫 48供給以加熱塊 57加熱的IC引線框架 41之小片觀整部 45上,並加熱,在熔融的焊 錫48上一面使為了抑制氧化的氧化防止氣體及還原氣體 56(参照圖 6)流動,一面進行 IC晶片 58的接合。

其次,参照圖 4、圖 5及圖 6說 明此習知裝置的動作。在這些圖中,將 IC引線框架 41以框架供給部 42搬運到搬運等執 43上,以框架傳送部 44進行 IC引線框架 41的間距傳送。小片觀整部 45一來到焊錫供給點 46,就使加熱塊 57上升,使小片觀整部 45預熱,再進行焊錫 48的預熱。

此外,以晶片搬運部 50 將晶片從晶片收容部 49定位於 IC 拾取部 51。其後,以 IC晶片轉載部 53 將 IC晶片 5.8 吸附搬運 到定位台 52。然後,以 IC晶片定位部 54 進行定位,等待。 將焊錫 48供給小片觀整部 45,一面進行預熱而一面以間距 傳送 IC引線框架 41,使以加熱 8/m熱到 360 ℃的加熱塊 57 上 升,再施加 360 ℃的預熱,使焊錫 48熔融。此時,使氧化

五、發明説明(2)

抑制氣體及退原氣體 56流到氣體環境氣罩 55內,以免焊錫 48氧化。小片觀整部 45一來到小片焊接點 59,就將定位的 IC晶片 58轉載到以焊接頭 60熔融的焊錫 48上,使其接合。又,在圖 4中,符號 47為將焊錫 48供給小片觀整部 45上的焊錫供給部。

[發明欲解決之課題]

在利用如上述之智知焊接裝置的焊接方法方面,由於為使焊接性良好而需使焊錫的氧化抑制氣體及還原用氣體流動,所以需要多餘的成本。此外,由於使用此氧化抑制氣體及還原氣體,所以IC引線框架的切換時必須交換氣體環境氣罩55等,有多餘需要切換時間的問題。

本發明係為解決如上述習知技術之問題點所完成的,其目的在於提供一種即使不用氧化抑制氣體及選原用氣體也可使擇接性良好,並且因不需要氧化抑制氣體及選原用氣體而不需要氣體環境氣罩55等,於1C引線框架等基材的切換時可大幅縮短接合裝置的切換時間的零件對基材之接合方法及接合裝置。

[解決課題之手段]

依據本發明的將零件接合於基材之方法,其特徵在於:包含將焊錫或銀焊料等接合材料供給接合基材零件的接合位置之製程;預熱零件,同時使零件觸接前述接合材料之製程;及,將供給基材之前述接合材料的位置從其背側之面加熱而使前述接合材料熔融之製程者。

依據本發明的將零件接合於基材之裝置,其特徵在於:

五、發明説明(3)

包含將焊錫或銀焊料等接合材料供給接合基材零件的接合位置之機構;預熱零件之機構;使零件觸接前述接合材料之機構;及,將供給基材之前述接合材料的位置從其習側之面加熱而使前述接合材料熔融之機構者。

依據本發明的將半導體晶片接合於引線框架之方法,其特徵在於:包含將焊錫供給引線框架的小片觀整上之製程;預熱半導體晶片,同時使半導體晶片觸接前述焊錫之製程,及,將前述小片觀整從供給前述焊錫之面的背側加熱而使前述焊錫熔融之製程者。

依據本發明的將半導體晶片接合於引線框架之裝置,其特徵在於:包含將焊錫供給引線框架的小片觀整上之機構;預熱半導體晶片之機構;使半導體晶片觸接前述焊錫之機構;及,將前述小片觀整從供給前述焊錫之面的背側加熱而使前述焊錫熔融之機構者。

[發明之實施形態]

在依據本發明的零件對基材之接合方法方面,係預先預熱零件,並使零件關接前述接合材料,同時預由將供給基材之前。接合材料的位置從其背側之面急速加熱而使前述接合材料熔融,進行接合。此時,前述接合材料也被施加來自前述所領熱的零件之熱,所以會關間熔融。因此,接合時的接合材料與便不供給氧化抑制氣體及選原氣體,也可以得到良好的接合。又,前述零件的預熱和零件對接合材料的觸接,係先預熱零件後使其觸接接合材料

在依據本發明的零件對基材之接合裝置方面,係預先預

...

煩請委員則示

本紅你正從是否變更原實質內容

多年10×18年1

五、發明説明(4)

然 零 件 · 並 使 零 件 觸 接 前 述 接 合 材 科 · 同 時 藉 由 將 供 給 基 材之前述接合材料的位置從其背側之面急速加熱而使前述 接合材料熔融,進行接合。此時,前述接合材料也被施加 **來 自 前 述 所 預 熱 的 零 件 之 熱 , 所 以 會 瞬 間 熔 融 。 因 此** 合 時 的 接 合 材 料 氣 化 少 , 即 使 不 供 給 氧 化 抑 制 氣 體 及 遷 原 又, 前述零件的預熱和零 氣體,也可以得到良好的接合。 作對接合材料的觸接,係先預熱零件後使其觸接接合材料 在依據本發明的半導體晶片對引線框架之接合方法方面 · 係 將 炤 錫 供 給 小 片 觀 塾 上 · 預 熱 半 導 體 晶 片 · 並 使 半 等 雅晶片 网接前述焊锡,同時藉由將前述小片觀整從供給前 述焊锡之面的滑侧加热而使前述焊锡熔融,進行接合。此 時 , 前 述 焊 錫 也 被 施 加 來 自 前 述 所 預 熱 的 半 等 體 晶 片 之 熱 , 所 从 會 瞬 間 熔 融 。 因 此 , 接 合 時 的 焊 錫 氧 化 少 供給氧化抑制氣體及選原氣體,也可以得到焊接性良好的 接合。又,前述半導體晶片的預熱和半導體晶片對焊錫的 臅接,係先預熱半導體晶片後使其觸接焊錫(接合材料)。 在依據本發明的半導體晶片對引線框架之接合裝置方面 係將焊錫供給小片觀墊上,預熱半導體晶片,並使半導 冠 品 片 厰 接 前 述 焊 錫 , 同 時 稽 由 將 前 述 小 片 觀 塾 從 供 給 前 述 焊 錫 之 面 的 背 侧 加 熱 而 使 前 述 焊 錫 熔 融 , 進 行 接 合 。 此 ,前述焊踢也被施加來自前述所預熱的半導體品片之熱

,所以會瞬間落融。因此,接合時的焊錫氯化少,即使不

供給氣化抑制氣體及還原氣體,也可以得到焊接性良好的

。又,前述半導體晶片的預熱和半導體晶片對焊錫的

五、發明説明(5)

腦接,係先預熱半導體晶片後使其屬接焊錫(接合材料)。 [實施例]

實施例1

以下,依據圖1及圖2說明本發明之實施例1。圖1為顯示依據實施例1之半導體晶片焊接裝置全體構造的圖,圖2為此裝置的一部分截面圖。在圖1及圖2中,1為IC引線框架供給部,2為框架傳送部,3為框架收容盒,4為晶片收容部,5為晶片搬運部,6為IC拾取部,7為焊錫供給部,8為IC晶片轉載部,9為IC晶片定位部,10為焊接頭,11為焊接點(接合點),12為搬運導軌,13為小片觀墊,14為IC引線框架,15為定位台,16為加熱器,17為夾頭預熱部,18為夾頭,19為IC晶片,20為加熱器,17為夾頭預熱部,18為夾頭,19為IC晶片,20為加熱塊,21為加熱器,22為焊

其次,說明此實施例1的動作。在上述構造中,將IC引線框架14以IC引線框架供給部1轉載到搬運導軌12上,以框架傳送部2進行IC引線框架14的間距傳送。IC引線框架14之小片觀墊13一來到焊接點(接合點)11,就以焊錫供給部7將焊錫22轉載到小片觀墊13上。此外,以晶片搬運部5將來自晶片收容部4的晶片定位於IC拾取部6。然後,將IC晶片19以IC晶片轉載部8吸附,搬運到定位台15。IC晶片定位部9進行此IC晶片19的定位,以焊接頭10進行焊接(參照圖2)。

此時的焊接方法如下:首先,將焊銀22轉載到IC引線框架14之小片觀整13上後,以焊接頭10之來頭18真空吸附在

五、發明説明(6)

定位台15上所定位的IC晶片。此來頭18以加熱器16及來頭預熱部17預熱到150℃。一面以所預熱的來頭18預熱IC晶片19轉載到小片觀整13上的焊錫22上,此時,IC晶片19只被預熱到150℃,所以在只使此IC晶片19接觸焊錫22的階段,焊錫22還不會熔融。

其次,和此 IC晶片 19轉載到焊錫 22上同時,使以加熱器 21加熱到 36.0℃的加熱塊 20上升,使此加熱塊 隔接小片觀整 13。藉此加熱小片觀整 13,使放在其上面的焊錫 22熔 融。藉此,進行 IC引線框架 14之小片觀整 13和 IC晶片 19的接合。此焊錫 22熔 融時,不只是來自小片觀整 13的 360℃之熱,來自預熱到前述 150℃的 IC晶片 19之熱也施加於前述焊錫 22,所以焊錫 22會瞬間熔融。因此,從焊錫 22熔 融到接合的時間極短,所以幾乎没有接合時的焊錫 22氧化。

如以上,依據此實施例,如習知即使不使用氧化抑制氣 體及還原用氣體 56(參照圖 6),也可以進行焊接性良好的 焊接。

又,如在此實施例1所述,預熱的IC晶片19轉載到焊錫22 上和加熱小片觀整13熔融焊錫22之時間上的前後關係,希望和預熱的IC晶片19轉載到焊錫22上同時進行加熱小片觀整13熔融焊錫22。否則,在焊錫22接合於IC晶片19之前,焊錫22熔融了,焊錫22有氧化程度的時間持續。

實施例2

其次,說明本發明之實施例2。在上述實施例1的接合裝置方面,搬運導軌12、框架傳送部2、框架收容盒3分別只

五、發明説明(7)

以 1個構成,但在此實施例 2的接合裝置方面,如圖 3所示,係分別各設 2個搬運等 軌 12a、框架傳送部 2a、框架收容盒 3a。而且,在 IC晶片定位部 9放 2個 IC晶片,對於 2個 IC晶片同時進行焊接。即,依據此實施例 2,可用 1台接合裝置同時進行 2個 IC晶片 19對 2個 引線框架 14的分別接合。因此,依據此實施例 2,可用 1台接合裝置進行半導體裝置 2台分的生產,所以將半導體裝置 2台分的生產與使用實施例 1的接合裝置 2台分的情况相比,可使裝置價格便宜 20~30%,並且裝置空間也可減少 20~30%。

[發明之效果]

在依據本發明的零件對基材之接合方法方面,由於使接合材料熔融而進行零件對基材的接合時,稍由對於特合的報告的關係的零件之熱,開始合合材料的接合的接合財化。即使不明使不分類與原氣體,也可以得到良好的接合。因與和與的供給的與節人的接合的接觸的與節人的發展與原氣體。如於時間。

在依據本發明的零件對基材之接合裝置方面,由於使接合材料熔融而進行零件對基材的接合時,藉由對前述接合材料也施加來自所預熱的零件之熱,瞬間熔融接合材料而進行接合,所以接合時的接合材料氣化少,即使不供給氧化抑制氣體及選原氣體的供給部,可使接合裝置

五、發明説明(8)

的製造成本大幅降低。此外,也不需要氣體環境氣罩等可大幅縮短引線框架切換時的裝置切換時間。

此外,在依據本發明的半導體晶片對引線框架之接合方法方面,接合時得錫稱由也施加來自所預熱的半導體晶片 之熱,而瞬間熔融,可在短時間進行接合。因此,接合時 的焊錫氧化少,即使不供給氣化抑制氣體及應氣體,也 可以得到良好的焊錫接合。因此,不需要氧化抑制氣體, 可以得到良好的焊錫接合。與與類似本大幅發 退原氣體的供給部,可使接合裝置的製造成本大幅降低。 此外,也不需要氣體環氣罩等,可大幅縮短引線框架切 換時的裝置切換時間。

世外,在依據本發明的半導體品片對引線框架之接合裝置方面,接合時焊錫箱由也施來自所預熱的半導體品片之熟,而瞬間絡,可在短時間進行接合。因此,接合時間以得到良好的焊錫接合。因此,不需要氣化如制氣體,可以得到良好的焊錫接合。因此,不需要氣化如制氣體。

[圖式之簡單說明]

圖 1 為 顯 示 依 據 本 發 明 實 施 例 1 的 半 導 體 晶 片 對 小 片 觀 墊 之 接 合 裝 置 全 體 構 造 的 圖 。

圖 2 為 圖 1 之 裝 置 的 一 部 分 截 面 圖。

园 3 為 顯 示 依 據 本 發 明 實 施 例 2 的 半 導 體 晶 片 對 小 片 觀 墊

五、發明説明(9)

圆 4 為 顯 示 習 知 半 導 體 晶 片 對 小 片 觀 塾 之 接 合 裝 置 全 體 構 造 的 圖。

圖 5 為 顯 示 圖 4 之 裝 置 焊 接 部 的 一 部 分 截 面 透 視 圖。 圖 6 為 圖 4 之 裝 置 之 氣 體 環 境 氣 部 的 截 面 圖。 [元 件 編 號 之 說 明]

- 1 IC引 線框架供給部。2、2a框架傳送部
- 3、3a 框架收容盒 4 晶片收容部
- 5 晶片搬運部 6 IC拾取部
- 7 焊錫供給部 8 IC晶片轉載部
- 9 IC晶片定位部 10 焊接頭
- 11焊接點(接合點) 12、12a搬運導軌
- 13小月襯墊 14 IC引線框架
- 15 定位台 16、21 加熱器
- 17 夾頭預熱部 18. 夾頭 19 IC晶片
- 20 加熱塊 22 焊錫

前先閱讀背面之注意事項再填寫本頁

:31

線

1.一種零件對基材之接合方法,係指將零件接合於基材之方法,其特徵在於:包含將接合材料供給接合基材零件的接合位置之製程;及在使零件觸接前述接合材料之製程內具有預熱前述零件之製程,且一面預熱前述零件而可使之觸接前述接合材料的同時,將供給基材之前述接合材料的位置從其背側之面加熱而使前述接合材料熔融之製程者。

2.一種零件對基材之接合裝置,係指將零件接合於基材之裝置,其特徵在於:包含將接合材料供給接合基材零件的接合位置之機構;及在使零件觸接前述接合材料之機構內具有預熱前述零件之預熱機構,且一面預熱前述零件而一面使之觸接前述接合材料的同時,將供給基材之前遊接合材料的位置從其背剛之而加熱而使前述接合材料熔融之機構者。

3.一種半導體晶片對引線框架之接合方法,係指將半導體晶片接合於引線框架之方法,其特徵在於:包含將焊錫供給引線框架的水片觀整上之製程;及在使半導體晶片關緩的域焊錫的製程內具有預熱半導體晶片的製程,且一面預熱前述半導體晶片而一面使之觸接前述焊錫的同時,將前述小片觀整從供給前述焊錫之面的背側加熱而使前述焊錫熔融之製程者。

4.一種半導體晶片對引線框架之接合裝置,係指將半導體晶片接合於引線框架之裝置,其特徵在於:包含將焊錫供給引線框架的小片觀墊上之機構;及在使半導體晶片觸

請委員明

示

木

蒙特正後是否變更原實質內容

to the state of th

六、申請專利範圍

接前述焊錫之機構內具有預熱半導體晶片之預熱機構,且一面以前述預熱機構預熱前述半導體晶片而一面使之觸接前述焊錫的同時,將前述小片觀整從供給前述焊錫之面的
別側加熱而使前述焊錫熔融之機構者。

5.如申請專利範圍第4項之半導體晶片對引線框架之接合裝置,其中預熱機係具備由加熱器及夾頭預熱部而預熱的夾頭者。

